

会 社 名 株式会社サムコインターナショナル研究所

登録銘柄 (店頭登録銘柄)

コード番号 6387

本社所在都道府県 京都府

(URL <http://www.samco.co.jp>)

本 社 所 在 地 京都府京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 辻 理

問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 経 理 部 長 山 田 史 郎

T E L (075) 621 - 7841

決 算 取 締 役 会 開 催 日 平成 15 年 9 月 19 日

中 間 配 当 制 度 の 有 無 有

定 時 株 主 総 会 開 催 日 平成 15 年 10 月 24 日

単 元 株 制 度 採 用 の 有 無 有 (1 単 元 1,000 株)

1. 15 年 7 月期の業績 (平成 14 年 8 月 1 日 ~ 平成 15 年 7 月 31 日)

(1) 経営成績

(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15 年 7 月期	3,435	( 15.8 )	416	( 0.4 )	395	( 8.9 )
14 年 7 月期	2,966	( 27.3 )	414	( 54.0 )	433	( 52.2 )

	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
15 年 7 月期	221 ( 8.6 )	44 53		4.7	5.5	11.5
14 年 7 月期	242 ( 48.7 )	49 54		5.4	5.9	14.6

- (注) 1. 持分法投資損益 15 年 7 月期 百万円 14 年 7 月期 百万円  
 2. 期中平均株式数 15 年 7 月期 4,889,140 株 14 年 7 月期 4,889,680 株  
 3. 会計処理の方法の変更 無  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1 株 当 た り 年 間 配 当 金			配 当 金 総 額 (年 間)	配 当 性 向	株 主 資 本 配 当 率
	円 銭	中 間 円 銭	期 末 円 銭			
15 年 7 月期	12 50		12 50	61	27.6	1.3
14 年 7 月期	12 50		12 50	61	25.2	1.3

(3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1 株 当 た り 株 主 資 本
	百万円	百万円	%	円 銭
15 年 7 月期	7,184	4,746	66.1	970 01
14 年 7 月期	7,053	4,592	65.1	939 29

- (注) 1. 期末発行済株式数 15 年 7 月期 4,889,140 株 14 年 7 月期 4,889,140 株  
 2. 期末自己株式数 15 年 7 月期 1,750 株 14 年 7 月期 1,750 株

(4) キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
15 年 7 月期	88	154	308	1,244
14 年 7 月期	386	30	446	1,620

2. 16 年 7 月期の業績予想 (平成 15 年 8 月 1 日 ~ 平成 16 年 7 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	1,760	185	100			
通 期	4,400	660	355	12 50		12 50

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 71 円 38 銭

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、添付書類の 7 ページを参照してください。

## 添付書類

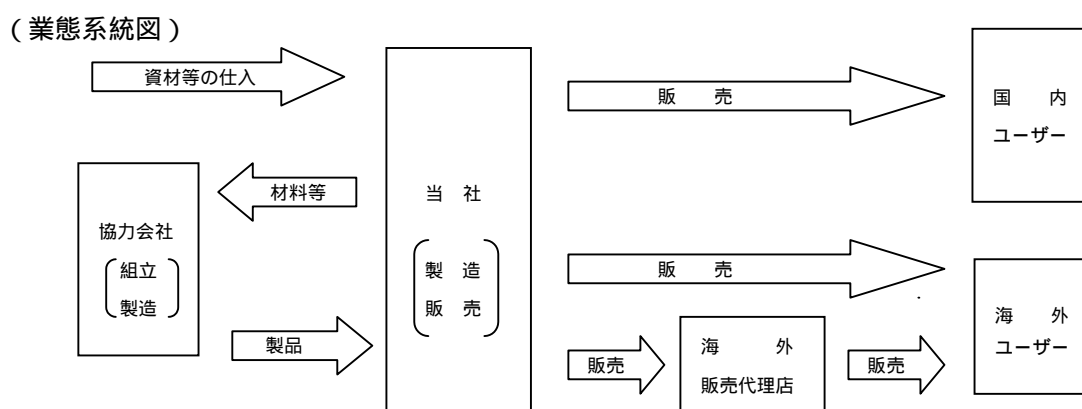
### 1. 企業集団の状況

当社は、単独で事業を営んでおり、関係会社はありません。

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。当社の基本となる薄膜形成技術はCVD法（Chemical Vapor Deposition = 化学的気相成長法）によるもので、当社の各装置においては、ナノテクノロジーと言われる10nm～100μmまでの成膜や加工が可能であります。（nm = ナノメートル：10億分の1メートル μm = マイクロメートル：1百万分の1メートル）

当社の製品は、薄膜を形成するCVD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うとともに、海外については一部現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。



当社は装置等を以下の通りに区分しております。

#### (CVD装置)

反応性の気体を基板の上に堆積させる装置で、一般に減圧下で半導体の絶縁膜、光学薄膜などを形成するために使われます。特に当社は発火性のガスを使用しない液体原料を活用したLS-CVD装置（LS = Liquid Source）に特徴があり、比較的低温反応で成膜速度が速く、均一性の良い成膜が可能です。

#### (エッチング装置)

各種半導体の基板の膜をはじめ微細加工に必要な材料を切削加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻していくものです。当社はICP（Inductive Coupled Plasma = 高密度プラズマ）を利用したエッチングに特徴があり、高速でかつ均一性の優れた加工が可能です。

#### (洗浄装置)

当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求されるフィルム状実装基板などに使用されております。

#### (その他装置)

上記装置には含まれない特別な装置であります。

#### (その他)

部品、保守メンテナンスなどがあります。

## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当社は「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」ことを経営理念とし、社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値の追求を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

### (2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けております。経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

### (3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

当社は、当社株式の流動性の向上と株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。特に1単元株式数の見直し等株式投資単位の引き下げにつきましては、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために実行すべき課題として認識しております。今後の業績動向、市況の変化を十分に勘案しつつ、引き続き検討しタイミングを見て対処していく所存であります。

### (4) 中期的な会社の経営戦略

当社は化合物半導体を中心としたオプトエレクトロニクス分野に経営資源を集中しながら、中期的には次の3点について戦略を展開してまいります。第一は、既に各種バックライトとして実用化の盛んなLED(Light Emitting Diode=発光ダイオード)や次世代大容量光ディスク用途向けに注目されているLD(Laser Diode=半導体レーザー)の量産化への対応及び各種センサーやチップが日々開発されて拡大している各種電子部品分野等への対応のため、本格的な量産用装置を開発し、メンテナンスを含めた販売力を強化していくこととあります。第二は、これらの分野も含めて、量産用と研究開発用が同時進行で拡大すると予想されている中国市場への積極展開であります。中国市場では既に商社と提携している一方、今後は独自の販売事務所の設置も視野に入れ、販売員の確保とサービス体制の確立を計画しております。第三は、CVD装置、エッチング装置、洗浄装置といった当社の三大製品群に匹敵するIT分野の第四の柱を確立することとあります。当社は、米国シリコンバレー、英国ケンブリッジとの3極体制で行っている研究開発と国内の大学や各種クラスターとの共同研究を行っておりますが、これらの中から、薄膜事業に関連する新事業、新分野をいち早く立ち上げ、当社の中期的な事業拡大に寄与する事業に成長させたいと考えております。

### (5) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社では、効率的で健全な企業経営システムを構築する上で、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な経営課題であると認識しており、常に組織の見直しと諸制度の整備に取り組んでおります。株主総会は、設立時からの7月決算を貫くことにより、参加しやすく開かれた総会を目指しており、また取締役会は、意思決定の迅速化と経営責任を明確化するため、月1回以上の開催を定例化し、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状況を管理監督しております。当社の取締役は5名ですが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しながら、開かれた運営を基本としております。当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役3名は全社員外監査役であり、取締役の職務執行の適法性と妥当性をチェックし、公正な意見が発言できる仕組みを作り上げております。内部統制については、社長室が年間計画に基づく業務監査を実施して、内部牽制の実効性を高めております。今後も、経営内容の透明性を高め各ステークホルダーから信頼される企業を目指して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

### (6) 対処すべき課題

#### 現状の認識について

現在、LED、LDが牽引役となるオプトエレクトロニクス市場が堅調なものの、他の分野の動きも目が離せない状況であり、的確にその動向を把握していく必要があると考えております。すなわち、オプトエレクトロニクス分野での光通信部門の回復時期、シリコン市場での国内メーカーの事業再編の動向、電子部品分野の高性能化への方向性に注目が集まり、また新エネルギー関連分野での新たな利用形態方法等が開発されている中、それぞれの分野の成長時期を目利きしていくことが重要と考え

ております。また、これらの展開はグローバル化しており、とりわけ中国市場は重点市場として早急に販売体制を確立する必要があると認識しております。

#### 当面の対処すべき課題の内容

当面の課題はオプトエレクトロニクス分野の LED、LD 用途向けへの量産用装置の投入と市場ニーズに合った量産用 CVD 装置の開発であります。さらには販売力強化が重点的課題であり、そのためには、人材教育とともに、海外部門も含めた適材適所の人材を確保する必要があると考えております。

#### 対処方針

量産用装置の本格的開発と販売力強化はスケジュール通り実行中ではありますが、適材適所の人材については、スキル保有人材を中心に各方面に広く門戸を開放し、中途採用を強化するとともに、独自の社内研修システムを確立していく方針であります。

#### 具体的な取組み状況等

重点部門を絞った中途採用人材の募集のみならず、広く業務提携についても検討中であります。ただし、先方の技術力の評価と当社の業容との相乗効果を考慮しながら決定していく方針であります。中国市場要員としては既に 1 名の採用と現地派遣社員として 1 名確保済みであります。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 当期の概況

当期のわが国経済は、輸出の増加や在庫調整の進展により、一部回復の兆しが見えたものの、後半には株式市場の低迷や新型コロナウイルス(SARS)パニック等により先行き不透明感が広がり、個人消費の低迷や雇用不安の増大なども手伝って、厳しい企業環境の中で推移しました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、パソコンやカメラ付き携帯電話及びデジタルカメラ等のデジタル家電関連を中心とした電子部品分野の設備投資が比較的堅調に推移したほか、自動車関連部品及び次世代大容量ディスク用途向けの青色LEDや青色LDを中心としたオプトエレクトロニクス分野は特に光源部門において比較的活発に推移いたしました。

こうした環境の中、当社は、青色LEDを中心としたオプトエレクトロニクス分野の光源部門において、従来から培った豊富な基礎技術や独自のプロセス技術を有しているエッチング装置を中心に市場の評価を得て、着実に販売実績を伸ばすことができました。一方、光導波路など期待した光通信部門においては、インフラを含めた通信関連機器需要の世界的な長期的低迷が影響し、この分野で支持を受けていたCVD装置の需要は期待はずれに終わりました。また、シリコン市場の後工程分野向けとして期待した洗浄装置は、福岡出張所を開設するなど販売面に力を注いだものの、市場の回復状況がやや一時的に終わり、計画を下回る結果となりました。

以上の結果、当期の売上高は3,435,852千円と前期比15.8%増加いたしました。利益面につきましては、販売競争からくる値下げ要請圧力により、売上総利益率が2.5%低下したことが影響し、経常利益は395,027千円と前期比8.9%減少し、また当期純利益は221,419千円と前期比8.6%減少いたしました。なお主な品目別の売上高は次の通りであります。

#### (CVD装置)

電子部品分野や表示デバイス分野の有機EL(Electro Luminescence)用途向けが健闘したものの、注力しているオプトエレクトロニクス分野において、光導波路用成膜装置として量産装置が大きく貢献した前期と比較して、市場の落込みが大きく、上期は大幅な減少となりました。

下期に入り、デジタルカメラ等に搭載されるマイクロレンズ成型過程での薄膜形成用途向け量産装置を出荷したり、その他分野において大学向け等に研究開発装置を出荷したりしたものの、オプトエレクトロニクス分野の、特に光通信部門の回復遅延が影響し、売上高は644,675千円(前期比35.5%減)の結果となりました。

#### (エッチング装置)

オプトエレクトロニクス分野の光源部門において、特に青色LEDの生産に不可欠なGaN(窒化ガリウム)のエッチング装置として市場の評価を得て、着実に販売実績を伸ばすことができました。

ただし、下期に入り、マイクロマシン等電子部品分野への研究開発用が予想以上に健闘したものの、前期比大幅増加を期待したオプトエレクトロニクス分野のエッチング装置において、特にICP装置に関して、予想以上の販売競争が影響し、売上高は2,081,472千円(前期比64.7%増)と下期計画を約360百万円下回る結果となりました。

#### (洗浄装置)

前期下期から広がり始めたシリコン市場の回復感から、今期は大幅な増加を期待しましたが、回復状況がやや一時的な現象に終わり、全体としては期待はずれに終わりました。ただし、下期に限ってみれば、BGA(Ball Grid Array=表面実装アレーの一種)基板や各種表示デバイスの表面処理用途及び各種研究機関でのコンパクト洗浄用途に当社の装置が健闘し、好調の兆しが見えた前期の下期に近い実績を計上することができ、売上高は326,641千円(前期比7.8%減)の結果となりました。

#### (その他装置)

エッチング装置に付帯する装置で、プロセスガス供給系及び排ガス用の特殊緊急除害装置の出荷があり、売上高は30,000千円(前期比37.8%減)となりました。

#### (その他)

既存装置のメンテナンスや改造及び部品販売が出荷台数の増加に伴い比較的安定的に推移し、売上高は353,062千円(前期比17.8%増)の結果となりました。

## (品目別売上高)

品 目	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
C V D 装 置	644,675	18.7	35.5
エッチング装置	2,081,472	60.6	64.7
洗 浄 装 置	326,641	9.5	7.8
そ の 他 装 置	30,000	0.9	37.8
そ の 他	353,062	10.3	17.8
合 計	3,435,852	100.0	15.8

なお、当社は装置により製造される半導体等電子部品をその用途により、LED・LD・DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex = 高密度波長多重伝送) 関連のオプトエレクトロニクス分野、各種センサー・磁気ヘッド・高周波デバイスなどの電子部品分野、半導体パッケージ技術や表面洗浄技術などの実装・表面処理分野、有機 EL や各種 LCD (Liquid Crystal Display = 液晶表示素子) 基板などの表示デバイス分野、その他分野、部品・メンテナンスに分類しており、その売上構成は次の通りであります。

## (用途別売上高)

用 途	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
オプトエレクトロニクス分野	1,699,471	49.4	21.4
電 子 部 品 分 野	828,023	24.1	22.9
実装・表面処理分野	208,900	6.1	8.8
表示デバイス分野	151,277	4.4	15.3
そ の 他 分 野	195,117	5.7	27.6
部品・メンテナンス	353,062	10.3	17.8
合 計	3,435,852	100.0	15.8

## (2) キャッシュ・フローの状況

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は税引前当期純利益が412,110千円(前期比0.6%減)となったものの、売上債権の増加額415,538千円、有形固定資産の取得による支出額121,687千円、長期借入金の返済による支出額177,500千円などのマイナス要因があったため、資金残高は前期末に比べ375,473千円減少となり、当期末には1,244,926千円(前期比23.2%減)となりました。また、当期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は88,998千円(前期比76.9%減)となりました。これは主に税引前当期純利益412,110千円(前期比0.6%減)、仕入債務の増加額186,941千円、減価償却費101,634千円がプラスに寄与したものの、売上債権の増加額415,538千円などがマイナスに作用したものであります。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は154,913千円(前期比401.2%増)となりました。その主な内容は定期預金の払出による収入1,667,392千円に対して、定期預金の預入による支出が1,701,554千円であったことと有形固定資産の取得による支出が121,687千円であったことによるものです。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は308,614千円(前期比30.9%減)となりました。これは、短期借入金の減少額70,000千円、長期借入金の返済額177,500千円、配当金の支払額61,114千円があったことによるものです。

### (3) 次期の見通し

次期の見通しにつきましては、当面はオプトエレクトロニクス分野での光源部門向けエッチング装置が引き続き堅調に推移する形で業績を牽引すると考えられますが、CVD 装置においても、デジタルカメラ等レンズ成型工程用途向けに期待が持てるのをはじめ、既に開発している量産型 CVD 装置の完成を待って、高速デバイス用途向け販売に大きな期待をしているところでもあります。また、洗浄装置につきましても、今期の下期から一部に回復感が出てきた流れに乗って、大きな期待はできないものの、比較的堅調に推移するものと思われれます。販売地域的には中国市場をはじめとした海外部門が、人材投入等の効果も出始め、売上増加に貢献できるものと考えております。

一方、今期低下した売上総利益率につきましては、設計段階から一層のコストダウンをはかるものの、特定機種に見られる販売競争がさらに激化する方向を勘案すると、目標とする 50%には若干届かない見込みであります。販売費及び一般管理費は、研究開発投資及び中途採用人材に関する人件費に対して、引き続き資源の投入を予定するものの、固定費の増加要因は限定的と見ており、対売上高比率は低下できるものと予想しております。

以上の見通しにより、売上高は 4,400 百万円（当期比 28.1%増）、経常利益は 660 百万円（当期比 67.1%増）、当期純利益は 355 百万円（当期比 60.3%増）となる見込みであります。